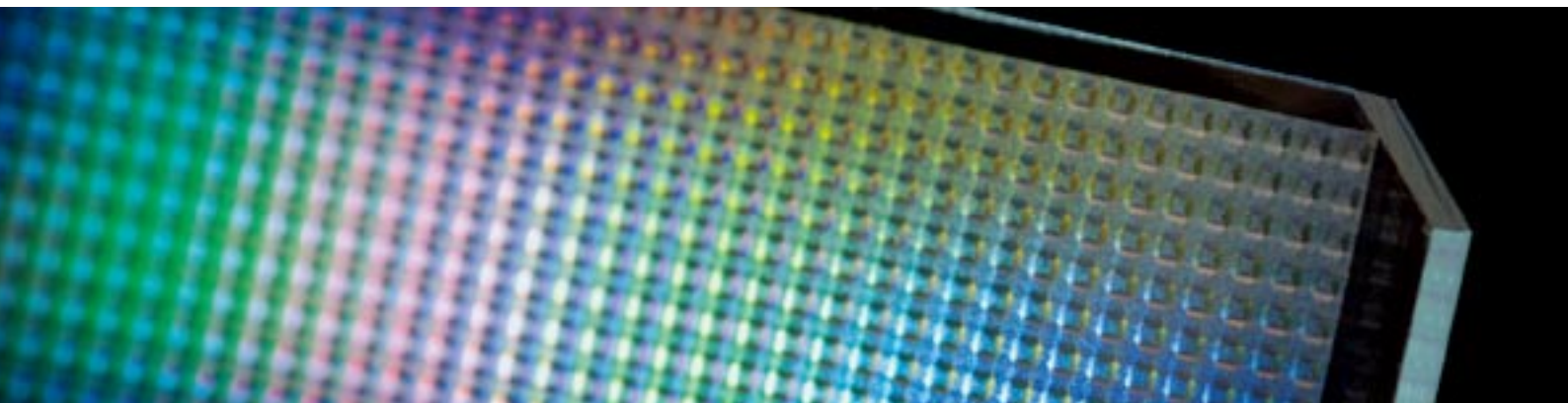




## 0次光の影響を抑えた回折光学素子



マスク照射型の露光機では、最高の解像度を得る為に、照明光源形状の最適化が必要となります。

イエナオプティックの回折光学素子 (DOE) は、高い精度と均一性で、これらのパターンを創造します。最高品質の基板を用い、強烈な紫外線レーザーの照射に対しても高い耐性を示します。

### 特長

- ・ 高精細で均一な多極パターン
- ・ 自由度の高い照射パターン
- ・ 多層構造により高効率
- ・ コストパフォーマンスの高いバイナリも可
- ・ 高耐エネルギー・高耐久性
- ・ 短納期でカスタム設計可能

### アプリケーション

- ・ 半導体リソグラフィ
- ・ レーザ加工
- ・ レーザ計測システム

# 0次光の影響を抑えた回折光学素子

## 仕様

波長：	193 nm to 2.5 $\mu$ m
最大効率：	94 % (多層, ARコート付きで) / 78 % (バイナリ, ARコート付きで)
最大NA (@ $\lambda=193$ nm)：	0.05 (多層) / 0.6 (バイナリ)
強度プロファイル：	照射パターン
極間バランス：	< 1 %
極間均一性：	< 5 %
0次回折光：	< 0.1 % (多層) / < 0.25 % (バイナリ)
開口径：	< 120 mm $\times$ 120 mm
硝材：	UVグレード融解石英, クォーツ
ARコート：	ご要望により
製品ナンバー：	029110

## イエナオプティックの回折光学素子による照射パターン

カテゴリ 0:

カテゴリ 1:

カテゴリ 2:



多極バイナリー出力



多極グレー階調出力



微細多極多階調出力 (SMOプロセス向け)

※仕様は予告なく変更することがあります。(2011年9月現在)